本期封面	1999年9期
	栏目:
	DOI:
论文题目:	离子注入Ce对Fe-23Cr-5A1合金上AI203膜生长应力的影响
作者姓名:	李美栓 钱余海 辛丽 周龙江
工作单位: 通信作者:	中国科学院金属腐蚀与防护研究所金属腐蚀与国家重点实验室, 沈阳 110015 李美栓
通信作者Email: msli@icpm. syb. ac. cn	
文章摘要:	利用双面氧化弯曲方法原位测量了 $Fe-23Cr-5Al$ 合金空气中氧化形成的 $AI2O3$ 膜平均生长应力. $AI2O3$ 膜内存在压应力. 900 ℃下氧化 $20h$, 膜内应力从 3.5 降低到 $2GPa$, 1000 ℃下氧化 $10h$, 膜内应力从 0.8 降低到 $0.4GPa$, 合金表面离子注入 1×10^1 7 C $10e^1$ + $10e^1$ 2 $10e^1$ 4 $10e^1$ 5 $10e^1$ 7 C $10e^1$ 6 $10e^1$ 6 $10e^1$ 6 $10e^1$ 7 $10e^1$ 7 $10e^1$ 8 降低到 $10e^1$ 6 $10e^1$ 7 $10e^1$ 7 $10e^1$ 8 降低到 $10e^1$ 6 $10e^1$ 7 $10e^1$ 7 $10e^1$ 8 降低到 $10e^1$ 6 $10e^1$ 7 $10e^1$ 8 降低到 $10e^1$ 7 $10e^1$ 8 降低到 $10e^1$ 8 中国 $10e^1$ 9 中国 $10e^1$ 8 中国 $10e^1$ 9 中国 $10e^1$ 8 中国 $10e^1$ 9 中国
关键词:	生长应力 高温氧化 离子注入 合金钢
分类号:	TG174.82 TG142.3

关闭